

メムス・コアの試作プロセスメニュー

分類	工程	プロセス材料・装置
成膜	絶縁膜形成 (SiO ₂ , NSG, PSG)	酸化炉、AP-CVD、P-TEOS、
	金属膜形成 (Au, Pt, Cr, Ti, Cu, 他)	スパッタ、EB蒸着、めっき
フォトリソ	レジスト塗布 露光 現像	スピナー、スプレーコーター、ラミネーター、 両面アライナー、直接露光装置、パターンジェネレーター
	マスク製造(Grマスク)	CAD、パターンジェネレーター
エッチング	ドライエッチング (Si, SiO ₂)	Deep RIE、RIE、ICP-RIE、犠牲層(SiO ₂ , Si)、 イオンミリング、O ₂ アッシャー
	ウェットエッチング (Si, SiO ₂ , 各種金属)	TMAH, KOH, 各種金属膜エッチング液
接 合	ウエハ接合	陽極接合、熱圧着接合、
実 装	ウエハ切断	ブレードダイシングソー、レーザーダイシングソー
	ボンディング	ワイヤーボンダー
研 磨	ウエハ研磨	CMP、CMP後洗浄
評 価		干渉式膜厚測定器、触針式段差測定器、SEM、シート抵抗測 定器、応力測定器、測定顕微鏡、レーザー顕微鏡
他ドライ処理	洗浄、表面改質	UV/O ₃ 処理、HMDS塗布

メムス・コアの開発・受託サービス

	コンセプト	詳細設計	試作	評価	量産(小規模)	
自主開発						PNセンサー AEセンサー
開発受託				★	★	
共同開発	★	★		★	★	
試作受託				★	★	



:カスタマ



:メムスコア



:ご相談

株式会社メムス・コア

URL: <http://www.memscore.com/>

e-mail: info@memscore.com

TEL: 022-777-8717 FAX: 022-777-8718